

Prove preliminari di realizzazione
di colonne in SU-8 su substrati di Si.

- Materiale a disposizione
 - 3 tipi di photoresist a diversa viscosità (SU-8 2005, 2002, 2000.5)
 - Substrati di prova in Si drogato
 - Developer
- Scelta del Photoresist
 - Da datasheet il migliore photoresist per la realizzazione di oggetti di spessore $1 \mu\text{m} < d < 5 \mu\text{m}$ pare essere il SU-8 2005, scelto per queste prove.

HV-CMOS Meeting 18/06/2014

- Realizzazione di pilastri in SU-8 2005 su substrati di prova a diverse velocità di rivoluzione
- Valori ottimali (datasheet) per ottenere uno spessore di 5 μm : $2000 \text{ rpm} < v_{\text{riv}} < 3000 \text{ rpm}$
- Altezze effettive parzialmente in accordo con il datasheet:
 - 2000 rpm = 3.8 μm
 - 2500 rpm = 3.3 μm
 - 2700 rpm = 3.6 μm
 - 3000 rpm = 2.8 μm

- E' necessario ricalibrare la curva di spinning per velocità di rotazione più basse
- Confronto tra misure ottenute al profilometro ottico e al profilometro meccanico.